

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-340846

(43)Date of publication of application : 22.12.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/027  
G03F 7/20

(21)Application number : 09-151985

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 10.06.1997

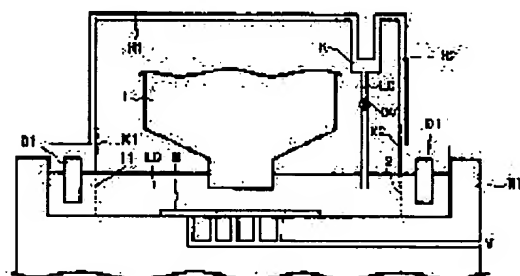
(72)Inventor : KUDO TAKETO

(54) ALIGNER, ITS MANUFACTURE, EXPOSING METHOD AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable continuous correction of imaging performance without vibration, by installing a refractive index adjusting means for adjusting the refractive index of liquid.

SOLUTION: A refractive index adjusting means consists of the following; electrodes D1, ion exchange films 11, 12, bulkheads K1, K2, exhaust pipes H1, H2, a mixer K, an electromagnetic valve DV, an introducing pipe LD, a power source supply part and a second control part. The second control part sends a command to the power source supply part, and applies a specified voltage for a specified period across the two electrodes D1. From one electrode turning to an anode, oxygen gas is generated. From the other electrode turning to a cathode, mixed gas of hydrogen and chlorine is generated. Since the concentration of hydrogen chloride in liquid LQ is decreased, the refractive index of the liquid LQ is decreased. The second control part sends a command to the electromagnetic valve DV, in order to open the valve DV and add high concentration admixture aqueous solution to the liquid LQ. Thereby the refractive index of the liquid LQ is increased.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**\* NOTICES \***

**JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

[Claim(s)]

[Claim 1] the aligner characterized by to have the illumination-light study system which illuminates the pattern prepared on reticle, and the projection optical system which forms the image of this pattern on a photosensitive substrate, and to have a refractive-index adjustment device for adjusting the refractive index of said liquid in the aligner exposed through the liquid which a part is boiled in the optical path between said projection optical systems and said photosensitive substrates at least, and is located.

[Claim 2] Said refractive-index adjustment device is an aligner according to claim 1 characterized by adjusting the refractive index of said liquid so that the image formation engine performance of said projection optical system may be amended.

[Claim 3] It is the aligner according to claim 2 which is further equipped with an image formation performance-measurement means to measure the image formation engine performance of said projection optical system, and is characterized by said refractive-index adjustment device adjusting the refractive index of said liquid so that said image formation engine performance may be amended.

[Claim 4] It is the aligner according to claim 1 which is further equipped with a fluctuation factor detection means to detect the condition of the factor of fluctuation of the image formation engine performance of said projection optical system, and is characterized by said refractive-index adjustment device adjusting the refractive index of said liquid so that said image formation engine performance may be amended according to the condition of said factor.

[Claim 5] It is the aligner according to claim 4 which said illumination-light study system is constituted possible [ modification of the lighting conditions over said reticle ], and said fluctuation factor detection means detects the condition of said lighting conditions, and is characterized by said refractive-index adjustment device adjusting the refractive index of said liquid so that said image formation engine performance may be amended according to modification of said lighting conditions.

[Claim 6] It is the aligner according to claim 4 which said fluctuation factor detection means distinguishes the class of said reticle, and is characterized by said refractive-index adjustment device adjusting the refractive index of said liquid so that said image formation engine performance may be amended according to the class of said reticle.

[Claim 7] It is the aligner of six claim 1 characterized by having further a photosensitive substrate electrode holder holding said photosensitive substrate, and equipping this photosensitive substrate electrode holder with the side attachment wall for filling the optical path between said projection optical systems and said photosensitive substrates with said liquid, and supply / recovery unit for collecting from said photosensitive substrate electrode holder while supplying said liquid to said photosensitive substrate electrode holder thru/or given in any 1 term.

[Claim 8] Said refractive-index adjustment device is the aligner of seven claim 1 characterized by having the additive supply unit which supplies the additive for adjusting a refractive index to said liquid, and an additive recovery unit for collecting said additives from said liquid thru/or given in any 1 term.

[Claim 9] The exposure approach characterized by to include the process which adjusts the refractive index of said liquid in order to amend the image-formation engine performance of said projection optical system under predetermined lighting conditions in the exposure approach of leading the light from said projection optical system to said photosensitive substrate through a predetermined liquid, including the process which illuminates reticle, and the process which imprints the pattern prepared on said reticle to a photosensitive substrate using a projection optical system.

[Claim 10] The process which illuminates reticle under predetermined lighting conditions, and the process which imprints the device pattern prepared on said reticle to a photosensitive substrate using a projection

optical system are included. The device manufacture approach characterized by changing the refractive index of said liquid in the device manufacture approach of leading the light from said projection optical system to said photosensitive substrate through a predetermined liquid when at least one side is changed among said reticle and said lighting conditions.

[Claim 11] It has the illumination-light study system which illuminates the pattern prepared on reticle, and the projection optical system which forms the image of this pattern on a photosensitive substrate. In the manufacture approach of the aligner which a part is boiled in the optical path between said projection optical systems and said photosensitive substrates at least, and is exposed through the located liquid The manufacture approach of the aligner characterized by including the process which measures the image formation engine performance of said projection optical system, and the process which defines the initial value of the refractive index of said liquid based on the this measured image formation engine performance.

---

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

**JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**DETAILED DESCRIPTION**

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the device manufacture approach at the exposure approach list using an aligner and this aligner equipped with the projection optical system which projects that of the device pattern prepared on reticle on a photosensitive substrate. This invention relates to the immersion photolithography system which filled up the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate with the liquid in more detail. In case this invention manufactures a semiconductor device, image sensors (CCD etc.), a liquid crystal display component, or the thin film magnetic head, it is suitable.

[0002]

[Description of the Prior Art] Although the space between the last side of optical system and the image surface was called working distance, working distance was filled with air according to the projection optical system of the conventional aligner. By the way, the detailed-ization is always desired, and the pattern exposed to a silicon wafer in the process in which IC and LSI are manufactured needs to shorten wavelength of the light used for exposure for that purpose, or needs to enlarge numerical aperture by the side of an image. The glass ingredient only with the permeability which can secure the quantity of light satisfied with exposure decreases obtaining the satisfying image formation engine performance as the wavelength of light becomes short.

[0003] Then, the aligner in which enlarging numerical aperture by the side of an image by using the last medium to the image surface as a liquid with a larger refractive index than air is proposed, and it has a projection optical system using a liquid such is called the immersion photolithography system. Now, in the aligner, in order to amend the image formation engine performance of a projection optical system, the technique of a projection optical system of preparing the optical path by the side of a body or the image formation engine-performance amendment member for adjusting the image formation engine performance into the optical path by the side of an image most exchangeable is known most.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, since it is the configuration of filling a liquid with an immersion photolithography system to the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate (working distance), it is difficult to arrange the member for amending the image formation engine performance. Moreover, since considering the configuration of the number of finite, and realistic equipment such an image formation engine-performance amendment member can prepare only extent partly, it has the trouble which cannot amend the discrete image formation engine performance.

[0005] Moreover, although it is necessary to store the image formation engine performance of a projection optical system in predetermined tolerance, if amendment of the image formation engine performance cannot be performed discretely as mentioned above, storing in this predetermined tolerance becomes difficult. If detailed-izing of an exposure pattern and buildup of exposure area are searched for especially, the tolerance of this image formation engine performance becomes narrow, and also when performing the scan exposure approach exposed making reticle and a photosensitive substrate scan, the tolerance of the range of fluctuation of image formation performance characteristics is narrow, and it cannot respond in discrete amendment.

[0006] Moreover, since the oscillation of the projection optical system itself occurs at the time of exchange of the above image formation engine-performance amendment members, there is also a possibility that an adverse effect may arise to the image formation engine performance. Then, this invention sets it as the 1st object to enable amendment of the continuous image formation engine performance, without being

accompanied by oscillation. Moreover, this invention sets coexistence with amending buildup and the image formation engine performance of the numerical aperture of a projection optical system as the 2nd object.

[0007]

[Means for Solving the Problem] in order to attain the 1st above-mentioned object, the aligner by this invention has the illumination-light study system which illuminates the pattern prepared on reticle, and the projection optical system which form the image of this pattern on a photosensitive substrate, and it is the aligner exposed through the liquid which a part is boiled in the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate at least, and is located, and has a refractive-index adjustment device for adjusting the refractive index of a liquid.

[0008] Here, according to the desirable mode hung up over above-mentioned claim 2, a refractive-index adjustment device adjusts the refractive index of a liquid so that the image formation engine performance of said projection optical system may be amended. According to the desirable mode hung up over claim 3 based on this configuration, it has further an image formation performance-measurement means to measure the image formation engine performance of a projection optical system, and a refractive-index adjustment device adjusts the refractive index of a liquid so that said image formation engine performance may be amended.

[0009] Moreover, according to the desirable mode hung up over claim 4, it has further a fluctuation factor detection means to detect the condition of the factor of fluctuation of the image formation engine performance of a projection optical system, and according to the condition of a factor, a refractive-index adjustment device adjusts the refractive index of a liquid so that the image formation engine performance may be amended. According to the desirable mode hung up over claim 5 based on this configuration, an illumination-light study system is constituted possible [ modification of the lighting conditions over said reticle ], a fluctuation factor detection means detects the condition of lighting conditions, and according to modification of lighting conditions, a refractive-index adjustment device adjusts the refractive index of a liquid so that the image formation engine performance may be amended.

[0010] And according to the desirable mode hung up over claim 6, a fluctuation factor detection means distinguishes the class of reticle, and according to the class of reticle, a refractive-index adjustment device adjusts the refractive index of a liquid so that the image formation engine performance may be amended. Moreover, in order to attain the 2nd above-mentioned object, it is desirable to fill all the optical paths between a projection optical system and a photosensitive substrate with a liquid. As for the aligner by this invention, at this time, it is desirable to have further the photosensitive substrate electrode holder which is equipped with the side attachment wall for filling the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate with said liquid and supply / recovery unit for collecting from said photosensitive substrate electrode holder while supplying a liquid to said photosensitive substrate electrode holder, and holds a photosensitive substrate.

[0011] Moreover, as for a refractive-index adjustment device, it is desirable to have the additive supply unit which supplies the additive for adjusting a refractive index to a liquid, and an additive recovery unit for collecting said additives from a liquid.

[0012]

[Embodiment of the Invention] In this invention like an above-mentioned configuration, since the refractive index of the liquid located in the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate can be adjusted, change of this refractive index can amend the image formation engine performance of a projection optical system. As the technique of refractive-index adjustment here, supposing a liquid is a mixed liquor object of many matter, the refractive index  $n$  of this mixed liquor object will follow the formula of Lorentz Lawrence (Lorentz-Lorenz), and it is [0013].

[Equation 1]

$$\left( \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right) = \sum_{i=1,2,\dots} m_{(i)} \times \left( \frac{n_{(i)}^2 - 1}{n_{(i)}^2 + 2} \right) \times \frac{\rho}{\rho_{(i)}}$$

[0014] It becomes. However, [0015]

[Equation 2]

$n_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の屈折率、

$m_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の重量分率、

$\rho_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の密度、

[0016] It comes out. For example, what is necessary is just to make the concentration of the matter added to a water solution fluctuate, since the refractive index of this water solution will change according to the concentration of the water solution itself, if a liquid is used as a water solution. If the refractive index of a liquid is changed so that this may become the value of the refractive index which can compensate the image formation engine performance of a projection optical system, the image formation engine performance of a projection optical system will become good.

[0017] Here, adjustment of a refractive index may measure image formation engine performance, such as aberration of a projection optical system, may adjust a refractive index according to the result, may detect fluctuation of the factor corresponding to fluctuation of the image formation engine performance of a projection optical system, and may adjust a refractive index according to the result. In the technique of measuring the image formation engine performance of the former projection optical system, the aberration of a projection optical system etc. may be measured at the time of manufacture of an aligner, and the value of the refractive index which compensates this aberration may be set as the initial value of the refractive index of a liquid. Thus, if a refractive index is adjusted as a part of adjustment at the time of manufacture, there is an advantage from which manufacture and adjustment become easy. Moreover, the aberration measurement device etc. is prepared in the aligner itself, and the refractive index of a liquid may be changed according to the aberration measurement result by this aberration measurement device.

[0018] On the other hand, as fluctuation of the factor corresponding to fluctuation of the latter image formation engine performance, the amount of exposure energy which passes the class of reticle, the condition of lighting conditions, and a projection optical system is mentioned. here, if the optimal thing is decided by the class of pattern established on reticle and lighting conditions at the time of illuminating reticle, such as etc., a sigma value and deformation lighting \*\*\*\*\* -- change this lighting condition according to it, the image formation engine performance which makes aberration of a projection optical system the start will change. What is necessary is to make memory etc. memorize beforehand the value of the refractive index for compensating the image formation engine performance which changes with fluctuation of this factor for every factors, such as a class of reticle, and lighting conditions, to detect fluctuation of this factor and just to adjust the refractive index of a liquid there based on the memorized relation. Moreover, what is necessary is to make memory etc. memorize beforehand the value of the refractive index for compensating the image-formation engine performance which changes with the size of the amount of exposure energy, and this amount of exposure energy also in this case, to detect fluctuation of this factor and just to adjust the refractive index of a liquid based on the memorized relation, although there is the so-called exposure fluctuation from which the image-formation engine performance of a projection optical system changes with the size of the amount of exposure energy which passes a projection optical system. In addition, in this technique, you may compute in a predetermined formula instead of making memory memorize.

[0019] Thus, it is effective for especially amendment of spherical aberration and a curvature of field among the image formation engine performance of a projection optical system by adjusting the refractive index of a liquid. Hereafter, the gestalt of operation concerning this invention is explained with reference to a drawing.

[Gestalt of the 1st operation] drawing 1 is drawing showing roughly the aligner by the gestalt of the 1st operation concerning this invention. In addition, XYZ system of coordinates are adopted in drawing 1.

[0020] In drawing 1, the light source S supplies exposure light with a wavelength of 248nm, and the exposure light from this light source S illuminates Reticle R under almost uniform illuminance distribution through the illumination-light study system IL and a reflecting mirror M. Here, although the KrF excimer laser is used as the light source S in this example instead, the high-pressure mercury lamp which supplies the ArF excimer laser which supplies 193nm exposure light, g line, i line, etc. may be used. Moreover, in drawing 1, although not illustrated, the illumination-light study system IL has the optical integrator for forming the surface light source, the capacitor optical system for condensing the light from this surface light source, and carrying out homogeneity lighting of the irradiated plane in superposition, and an adjustable aperture diaphragm for being arranged in the location of the surface light source formed by the optical integrator, and making the configuration of the surface light source adjustable. Here, it is what has two or more surface light sources which carried out eccentricity from the optical axis as a configuration of the surface light source, the thing of a zona-orbicularis configuration, and a circle configuration, and the magnitude has a so-called thing etc. As such an illumination-light study system IL, what is indicated by the U.S. Pat. No. 5,329,094 official report and the U.S. Pat. No. 5,576,801 official report, for example can be used.

[0021] And the exposure light which passed and diffracted Reticle R reaches on Wafer W through a projection optical system T, and the image of Reticle R is formed on a wafer. Here, Reticle R is held by the reticle loader RL, and the reticle loader RL is constituted so that it can move at the rate of arbitration on the X-axis and a Y-axis with a driving gear T1 in the loader table LT top at the time of arbitration. Here, the passing speed on the loader table LT of a reticle loader RL is detected by the rate sensor SS, and the output from this rate sensor SS is transmitted to the 1st control section CPU 1.

[0022] Moreover, Wafer W is held on the wafer table WT. The side attachment wall for collecting Liquids LQ is prepared in this wafer table WT. In this example, it has the composition that all the optical paths from Wafer W to a projection optical system T are filled with Liquid LQ, with this side attachment wall. This wafer table WT is constituted so that it can move to X shaft orientations and Y shaft orientations at the rate of arbitration on the electrode-holder table HT with a driving gear T2.

[0023] Here, the 1st above-mentioned control section CPU 1 computes the passing speed on the electrode-holder table of the wafer table WT from the passing speed on the loader table LT of a reticle loader RL, and the exposure scale factor beta of a projection optical system T, and transmits it to a driving gear T2. A driving gear moves the wafer table WT based on the passing speed transmitted from the 1st control section CPU 1.

[0024] Drawing 2 is drawing which expressed the configuration of this wafer table WT to the detail. this drawing 2 -- setting -- a projection optical system T -- most, between the optical member by the side of Wafer W, and the metal flask of a projection optical system T, it has stuck so that Liquid LQ may not permeate, or packing is carried out. Moreover, two or more openings are prepared in the pars basilaris ossis occipitalis of the wafer table WT, and Wafer W is adsorbed by the wafer table WT by decompressing from the piping V connected to these openings. And electrodes D1 and D2 are formed in the wafer table WT, and ion exchange membrane I1 and I2 is formed in each perimeter of these electrodes D1 and D2. The perimeter of electrodes D1 and D2 and the field where exposure light passes Liquid LQ are divided by such ion exchange membrane I1 and I2. Here, the ambient atmosphere around an electrode D1 serves as a closed space by ion exchange membrane I1 and the septum K1, and the exhaust pipe H1 is connected to this closed space. Moreover, the ambient atmosphere around an electrode D2 serves as a closed space by ion exchange membrane I2 and the septum K2, and the exhaust pipe H2 is connected to this closed space. Both these exhaust pipes H1 and H2 are connected to Mixer K. The end of the introductory tubing LD equipped with the solenoid valve DV is connected to this mixer K, and the other end of this introductory tubing LD is located near the wafer table WT.

[0025] The seal-of-approval electrical potential difference which the seal-of-approval electrical potential difference to electrodes D1 and D2 is supplied from the current supply section without a graphic display, and the current supply section supplies is controlled by the 2nd control section CPU 2. Moreover, \*\* and the 2nd control section CPU 2 control also about closing motion of a solenoid valve DV. These electrodes D1 and D2, ion exchange membrane I1 and I2, septa K1 and K2, exhaust pipes H1 and H2, Mixer K, a solenoid valve DV, the introductory tubing LD, the current supply section without a graphic display, and the 2nd control section CPU 2 constitute the refractive-index adjustment device from this example.

[0026] Hereafter, actuation of a refractive-index adjustment device is explained. In the following explanation, Liquid LQ supposes that a hydrogen chloride is added to pure water as an additive. First, when lowering the refractive index of Liquid LQ, as for the 2nd control section CPU 2, only predetermined time amount carries out the \*\* mark of the predetermined electrical potential difference for a command between delivery, an electrode D1, and an electrode D2 to the current supply section. At this time, an oxygen gas occurs from the electrode used as an anode plate, and the gaseous mixture of hydrogen and chlorine occurs from the electrode used as cathode. Since the hydrogen chloride concentration in Liquid LQ falls at this time, as shown also in the above-mentioned (1) formula, the refractive index of Liquid LQ falls. Since the gas generated near each electrodes D1 and D2 does not pass ion exchange membrane I1 and I2, it can be collected through exhaust pipes H1 and H2 here. This collected gas is sent to Mixer K. In Mixer K, the collected gas (an oxygen gas, a hydrogen gas, hydrogen chloride gas) is mixed, and the additive water solution of high concentration [ Liquid / LQ ] is generated from this.

[0027] Moreover, when gathering the refractive index of Liquid LQ, the 2nd control section CPU 2 sends a command to a solenoid valve DV so that a solenoid valve DV may be opened and a high-concentration additive water solution may be added to Liquid LQ. Thereby, the refractive index of Liquid LQ rises. By this configuration, the refractive index of Liquid LQ is made to adjustable. Now, it corresponds to the memory M1 connected to the 2nd control section CPU 2 for every various lighting conditions, and the value of a refractive index is memorized in the form of a table. Here, the value of a refractive index is a value of



the refractive index of the liquid LQ required in order to amend the aberration produced in a projection optical system T under a certain lighting condition. Moreover, the value of the additive concentration in the liquid LQ at a certain event is kept by this memory M1 in the form always updated.

[0028] Moreover, the above-mentioned illumination-light study system IL is connected with the 2nd control section CPU 2 in order to transmit the information about the configuration of the surface light source which this illumination-light study system IL forms to the 2nd control section CPU 2. Here, in the example of a lighting condition-book, change of configuration - of the surface light source transmits this information to the 2nd control section CPU 2. At this time, the 2nd control section CPU 2 searches the value of the refractive index corresponding to the transmitted lighting conditions from memory M1, and calculates the concentration of the additive for realizing that refractive index from the above-mentioned (1) formula. Next, the 2nd control section CPU 2 controls electrodes D1 and D2 or a solenoid valve DV to consider as the additive concentration which had current additive concentration calculated according to the current additive concentration currently kept by memory M1 and the calculated additive concentration.

[0029] Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended.

It differs greatly in that the gestalt of [gestalt of the 2nd operation] the 2nd operation used the additive in the gestalt of the 1st operation as ethyl alcohol. This ethyl alcohol does not dissolve the resist layer of the wafer W with which the resist as a photosensitive substrate was applied, but has an advantage with little effect on the optical coat in a projection optical system T most given to the optical member (optical member which touches Liquid LQ) and this optical member by the side of Wafer W.

[0030] Moreover, in the gestalt of the 2nd operation, the configuration of a refractive-index adjustment device differs from the thing of the gestalt of the 1st operation. Hereafter, with reference to drawing 3, it explains per configuration of a refractive-index adjustment device. In addition, in drawing 3, the same sign is given to the member which has the same function as what was shown in drawing 2. In drawing 3 which shows the wafer table WT by the gestalt of the 2nd operation, the thing of the gestalt of the 1st operation is the point of having the exhaust pipe L which discharges Liquid LQ so that the pure-water supply pipe WS and Liquid LQ for supplying the additive supply pipe LS and pure water for a different point supplying an additive to Liquid LQ to Liquid LQ may not overflow from the wafer table WT.

[0031] Here, the solenoid valve DVL for adjusting the solenoid valves DVLS and DVWS for adjusting the amount of supply of an additive and pure water and the discharge of Liquid LQ to the additive supply pipe LS, the pure-water supply pipe WS, and an exhaust pipe L is formed, respectively, and closing motion of these solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL is controlled by the 2nd control section CPU 2. The actuation at the time of the refractive-index adjustment in the gestalt of the 2nd operation is explained.

[0032] First, when gathering the refractive index of Liquid LQ, a solenoid valve DVLS is controlled and, as for the 2nd control section CPU 2, only a predetermined amount adds an additive to Liquid LQ. At this time, only a predetermined amount discharges Liquid LQ from an exhaust pipe L. As for the amount of this liquid LQ to discharge, it is desirable that it is the same as the amount of the added additive. Thereby, the additive concentration in Liquid LQ increases and the refractive index rises.

[0033] Moreover, when lowering the refractive index of Liquid LQ, a solenoid valve DVWS is controlled and, as for the 2nd control section CPU 2, only a predetermined amount adds pure water to Liquid LQ. At this time, only a predetermined amount discharges Liquid LQ from an exhaust pipe L. As for the amount of this liquid LQ to discharge, it is desirable that it is the same as the amount of the added pure water. Thereby, the additive concentration in Liquid LQ becomes low, and the refractive index falls.

[0034] Here, the amount of the additive added and pure water and the amount of the liquid LQ to discharge are controlled by the 2nd control section CPU 2. In addition, the point that the value of a refractive index be memorize in memory M1 corresponding to the class of lighting conditions, and the point that the value of the additive concentration of the liquid LQ at a certain event be keep be the same as the gestalt of the 1st operation of a \*\*\*\*, and the point of them which calculate the additive concentration for realize the refractive index which can amend the aberration of a projection optical system T based on such information be the same as the gestalt of the 1st operation.

[0035] Thus, the 2nd control section CPU 2 in the gestalt of the 2nd operation controls closing motion of solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL to consider as the additive concentration which had current additive concentration calculated according to the current additive concentration currently kept by memory M1 and the calculated additive concentration. Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended.

The gestalt of the 3rd operation is explained with reference to [the gestalt of the 3rd operation], next



drawing 4 . The aligner by the gestalt of the 3rd operation differs from the gestalt of the above-mentioned 1st and the 2nd operation at a point equipped with the aberration measuring device. In addition, in drawing 4 , the same sign is given to the member which has the same function as the example of above-mentioned drawing 1 - drawing 3 , and the same XYZ system of coordinates as drawing 1 are adopted.

[0036] In drawing 4 , the light source S supplies exposure light with a wavelength of 248nm, and after the exposure light from this light source S is prepared according to the beam plastic surgery optical system 11 in the cross section of a predetermined configuration, it carries out incidence of it to the 1st fly eye lens 12. The secondary light source which consists of two or more light source images is formed in the injection side of the 1st fly eye lens 12. Incidence of the exposure light from this secondary light source is carried out to the 2nd fly eye lens 15 through the relay lens systems 13F and 13R. This relay lens system consists of pre-group 13F and rear group 13R, and oscillating Miller 14 for preventing the speckle on an irradiated plane is stationed among such pre-group 13F and rear group 13R.

[0037] Now, two or more formation of the image of the secondary light source by the 1st fly eye lens is carried out, and this serves as the 3rd light source at the injection side side of the 2nd fly eye lens 15. The adjustable aperture diaphragm 16 which can set up two or more aperture diaphragms which have a predetermined configuration or predetermined magnitude in the location in which this 3rd light source is formed is arranged. This adjustable aperture diaphragm 16 forms six aperture diaphragms 16a-16e by which patterning was carried out on the transparence substrate which consisted of quartzes etc. in the shape of a turret, as shown in drawing 5 . Here, two aperture diaphragms 16a and 16b with circular opening are drawing for changing a sigma value (numerical aperture of the illumination-light study system to the numerical aperture of a projection optical system), and two aperture diaphragms 16c and 16d with a zona-orbicularis configuration are drawing with which zona-orbicularis ratios differ mutually. And the two remaining aperture diaphragms 16e and 16f are drawing which has four openings which carried out eccentricity. With the adjustable aperture-diaphragm actuation unit 17, this adjustable aperture diaphragm 16 is driven so that any or 1 of two or more aperture diaphragms 16a-16f may be located in an optical path.

[0038] Returning to drawing 4 , it is condensed by the condensing lens system 18 and the exposure light from the adjustable aperture diaphragm 16 illuminates a reticle blind 19 top in superposition. The reticle blind 19 is arranged about the relay optical system 20F and 20R conjugate [ of Reticle R / the pattern formation side and conjugate ], and the configuration of the lighting field on Reticle R is determined by the opening configuration of a reticle blind 19. The exposure light from a reticle blind 19 forms the lighting field of uniform illuminance distribution in the position on Reticle R substantially through rear group 20R of pre-group 20F of relay optical system, a reflecting mirror M, and relay optical system.

[0039] In addition, the illumination-light study system IL in the gestalt of the above-mentioned 1st and the 2nd operation can also apply the beam plastic surgery optical system 11 shown in the gestalt of this operation - the relay optical system 20F and 20R. Now, Reticle R is laid on the reticle loader RL, and this reticle loader RL is movable on the electrode-holder table LT to the XY direction in drawing, and the hand of cut (the direction of theta) centering on the Z-axis. The migration mirror RIM is formed in this reticle loader RL, and the reticle interferometer RI detects the location of the XY direction of a reticle loader RL, and the direction of theta to it. Moreover, a reticle loader RL is driven in the XY direction and the direction of theta with the reticle loader actuation unit RLD. Here, the output from the reticle interferometer RI is transmitted to the 1st control section CPU 1, and the 1st control section CPU 1 has composition which controls the reticle loader actuation unit RLD.

[0040] Moreover, the bar code reader BR for reading the bar code prepared in Reticle R in the middle of the conveyance way from a reticle stocker without a graphic display is formed. The information about the class of reticle R which this bar code reader BR read is transmitted to the 2nd control section CPU 2. Here, the value of the refractive index of the optimal liquid LQ is remembered to be the information about the optimal lighting conditions for every class of reticle R for every class of reticle R by the memory M1 connected to the 2nd control section CPU 2.

[0041] the projection optical system T which has predetermined cutback scale-factor  $|\beta|$  prepares in Reticle R bottom -- having -- \*\*\*\* -- this projection optical system T -- between the optical member by the side of a wafer side, and Wafer W, Liquid LQ intervenes most. A projection optical system T forms the cutback image of Reticle R on a wafer side through this liquid LQ. Adsorption immobilization of the wafer W is carried out at the wafer table WT, and this wafer table WT is attached in the XY direction to the surface plate on the movable wafer stage WTS through the Z actuators ZD1, ZD2, and ZD3 for making migration to Z shaft orientations of wafer table WT itself, and a tilt (inclination to the Z-axis) perform. This wafer stage WTS is driven with the wafer stage actuation unit WD. Moreover, mirror plane processing is

performed and this part of the side attachment wall of a wafer table serves as a migration mirror of the wafer interferometer WI. Here, actuation of the wafer stage actuation unit WD is controlled by the 1st above-mentioned control section CPU 1, and the output from the wafer interferometer WI has composition transmitted to the 1st control section CPU 1.

[0042] Moreover, the focal sensor AF for measuring the distance of the Z direction between a projection optical system T and Wafer W is formed in the projection optical system T. This focal sensor AF receives the light which irradiated light on the wafer side through the optical element near the wafer W side in a projection optical system T, and was reflected with the wafer through the above-mentioned optical element, and measures the distance of the Z direction between a projection optical system T and Wafer W with that light-receiving location. The configuration of such a focal sensor AF is indicated by JP,6-66543,A.

[0043] Now, also in the gestalt of the 3rd operation, it has the pure-water supply pipe WS for supplying the pure water stored in the additive supply pipe LS and the pure-water storage section WST for supplying the high-concentration additive water solution stored in the additive storage section latest starting time to Liquid LQ to Liquid LQ, and the solenoid valves DVLS and DVWS for adjusting the amount of supply of an additive water solution and pure water are formed in the additive supply pipe LS and the pure-water supply pipe WS. Moreover, the exhaust pipe L for discharging Liquid LQ is formed in the wafer table WT so that Liquid LQ may not overflow from a wafer table, and the solenoid valve for adjusting the discharge of Liquid LQ is formed in this exhaust pipe L. Closing motion of these solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL is controlled by the 2nd control section CPU 2 like the gestalt of the 2nd operation of a \*\*\*\*.

[0044] Moreover, on the wafer table WT, the additive concentration detecting element DS for detecting the additive concentration of the aberration test section AS for measuring the aberration of a projection optical system and Liquid LQ is formed. Here, as an aberration test section AS, what is indicated by JP,6-84757,A, for example can be used. Here, the output from the aberration test section AS and the additive concentration detecting element DS is transmitted to the 2nd control section CPU 2. Moreover, the output from the additive concentration detecting element DS minds the 2nd control section CPU 2, and is kept as a value of the additive concentration of the liquid LQ at a certain event to memory M1.

[0045] Next, actuation of the gestalt of the 3rd operation is explained. First, while Reticle R being taken out from a reticle stocker without a graphic display, and being laid on a reticle loader RL, a bar code reader BR reads the bar code prepared in Reticle R, and transmits the information to the 2nd control section CPU 2. The 2nd control section CPU 2 reads the information about the lighting conditions corresponding to the class of reticle R memorized by memory M1, controls the adjustable aperture-diaphragm actuation unit 17 according to the information, and locates one of aperture diaphragms 16a-16f predetermined in an optical path. Moreover, the 2nd control section CPU 2 calculates the concentration of the additive for realizing the refractive index from the above-mentioned (1) formula based on the value of the refractive index of the liquid LQ memorized by memory M1. Then, closing motion of solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL is controlled to consider as the additive concentration which had current additive concentration calculated according to the current additive concentration which is detected by the additive concentration detecting element DS and kept by memory M1, and the calculated additive concentration.

[0046] Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended. Then, the focal sensor AF detects the location and tilt of a Z direction of Wafer W, and the Z actuators ZD1, ZD2, and ZD3 are driven so that Wafer W may become a necessary location. In this condition, the exposure light from the light source S is led to Reticle R through an illumination-light study system, and the 1st control section CPU 1 detecting the location of Reticle R and Wafer W with the reticle interferometer RI and the wafer interferometer WI, it makes the reticle loader actuation unit RLD and the wafer stage actuation unit WD drive, and moves Reticle R and Wafer W under the velocity ratio of projection scale-factor  $|\beta|$  of a projection optical system T. Thereby, the pattern on Reticle R is imprinted on Wafer W under a good image formation condition.

[0047] Now, the image formation engine performance (aberration etc.) of a projection optical system T always may not be fixed, and it may change with a temperature change, atmospheric pressure change, the temperature rises by a projection optical system T absorbing exposure light, etc. So, with the gestalt of the 3rd operation, the aberration (image formation engine performance) of the actual projection optical system T is measured by the aberration test section AS, and it is considering as the configuration which adjusts the value of the refractive index of Liquid LQ based on this measurement result.

[0048] With the gestalt of the 3rd operation, it is the form where the aberration value of a projection optical system was made to correspond in memory M1, and, specifically, the value of the refractive index of the liquid LQ which can amend the aberration is memorized. And the aberration of the projection optical system

T detected by the aberration test section AS is transmitted to the 2nd control section CPU 2. The 2nd control section CPU 2 reads the value of the refractive index of the liquid LQ memorized in memory M1, it asks for additive concentration from the above-mentioned (1) formula so that it may become the value of this refractive index, and it controls closing motion of solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL so that Liquid LQ serves as that additive concentration.

[0049] Even if there is an environmental variation (a temperature change, atmospheric pressure fluctuation, fluctuation by exposure optical absorption) of a projection optical system T, that image formation engine performance is maintainable good with this configuration. In addition, what is necessary is not to always perform measurement by this aberration test section AS, and just to carry out for every predetermined period.

[the gestalt of the 4th operation] -- with reference to drawing 6, the gestalt of the 4th operation is explained below. The gestalt of the 4th operation is considered as the configuration which fills a part of this optical path with a liquid instead of the configuration which fills all the optical paths between a projection optical system and a wafer with a liquid.

[0050] In drawing 6 (a) and (b), the same sign is laid down on the member which has the 1st shown in drawing 1 -3, and the same function as the gestalt of the 2nd operation. The configuration which fills Liquid LQ with the gestalt of the 4th operation in the containers C [ C1 and ] 2 which consisted of ingredients (for example, quartz etc.) which make exposure light penetrate instead of [ which is shown in drawing 6 (a) and (b) ] collecting Liquids LQ with the side attachment wall of wafer holder-WT differs from the gestalt of the above-mentioned 1st and the 2nd operation. By this configuration, although there is no effectiveness of numerical-aperture buildup or effectual depth of focus amplification among the effectiveness which the gestalt of the above-mentioned 1st and the 2nd operation had, it has the effectiveness whose aberration (image formation engine performance) adjustment of a projection optical system T is attained continuously.

[0051] In addition, in the gestalt of this 4th operation, the containers C1 and C2 currently put into Liquid LQ may be formed in a projection optical system T and one. With the above gestalt of the 1st - the 4th operation, although pure water was used as a liquid LQ, it is not restricted to pure water.

[0052]

[Effect of the Invention] As shown above, according to this invention, the image formation engine performance of a projection optical system can be adjusted continuously without an oscillation. Moreover, it becomes possible to reconcile buildup (or amplification of the effectual depth of focus) of numerical aperture, and adjustment of the image formation engine performance.

---

[Translation done.]

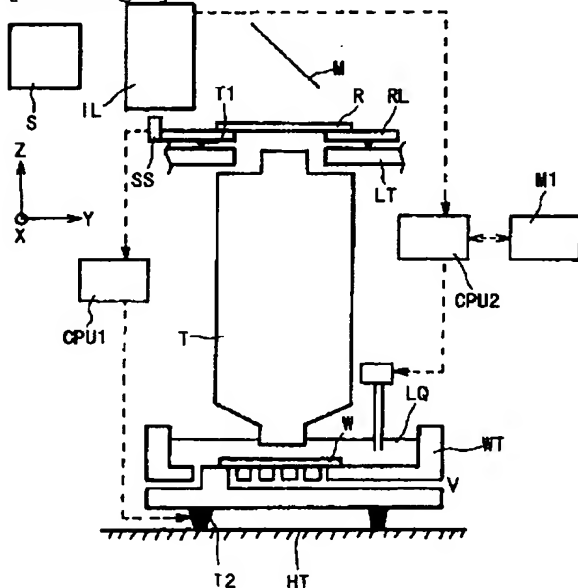
## \* NOTICES \*

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

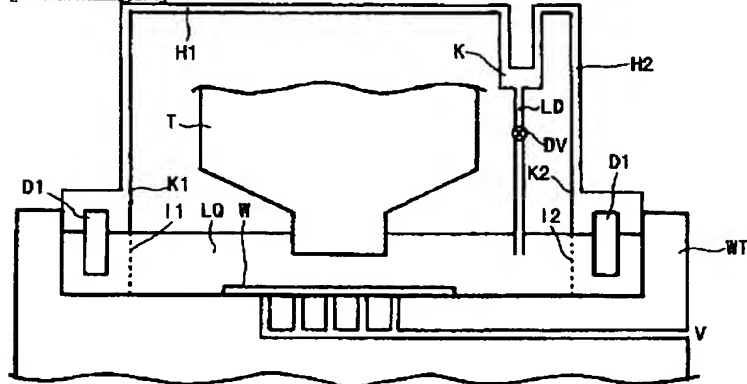
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DRAWINGS

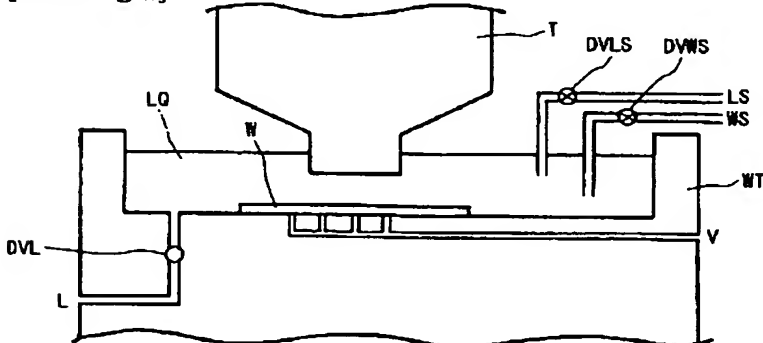
[Drawing 1]



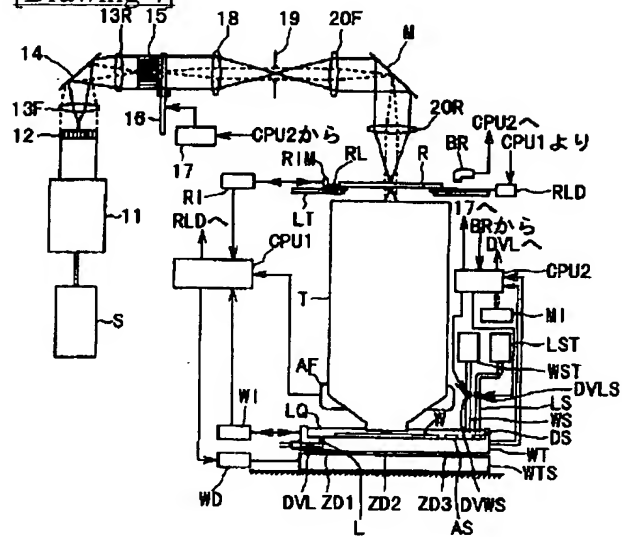
[Drawing 2]



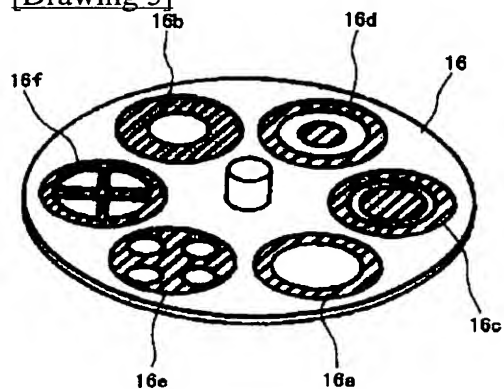
[Drawing 3]



[Drawing 4]

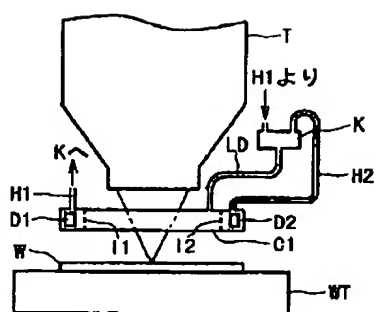


[Drawing 5]

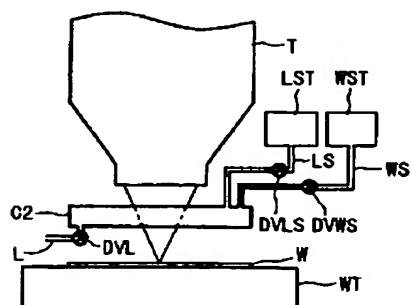


[Drawing 6]

(a)



(b)



---

[Translation done.]



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-340846

(43)Date of publication of application : 22.12.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number : 09-151985

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 10.06.1997

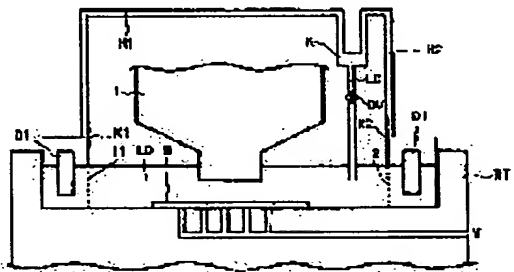
(72)Inventor : KUDO TAKETO

## (54) ALIGNER, ITS MANUFACTURE, EXPOSING METHOD AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To enable continuous correction of imaging performance without vibration, by installing a refractive index adjusting means for adjusting the refractive index of liquid.

**SOLUTION:** A refractive index adjusting means consists of the following; electrodes D1, ion exchange films 11, 12, bulkheads K1, K2, exhaust pipes H1, H2, a mixer K, an electromagnetic valve DV, an introducing pipe LD, a power source supply part and a second control part. The second control part sends a command to the power source supply part, and applies 8 specified voltage for a specified period across the two electrodes D1. From one electrode turning to an anode, oxygen gas is generated. From the other electrode turning to a cathode, mixed gas of hydrogen and chlorine is generated. Since the concentration of hydrogen chloride in liquid LQ is decreased, the refractive index of the liquid LQ is decreased. The second control part sends a command to the electromagnetic valve DV, in order to open the valve DV and add high concentration admixture aqueous solution to the liquid LQ. Thereby the refractive index of the liquid LQ is increased.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than  
the examiner's decision of rejection or  
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-340846

(43)公開日 平成10年(1998)12月22日

(51)Int.Cl.\*

識別記号

F I

H 0 1 L 21/027

H 0 1 L 21/30

5 1 5 D

G 0 3 F 7/20

5 2 1

G 0 3 F 7/20

5 2 1

H 0 1 L 21/30

5 1 6 A

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平9-151985

(22)出願日

平成9年(1997)6月10日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 工藤 威人

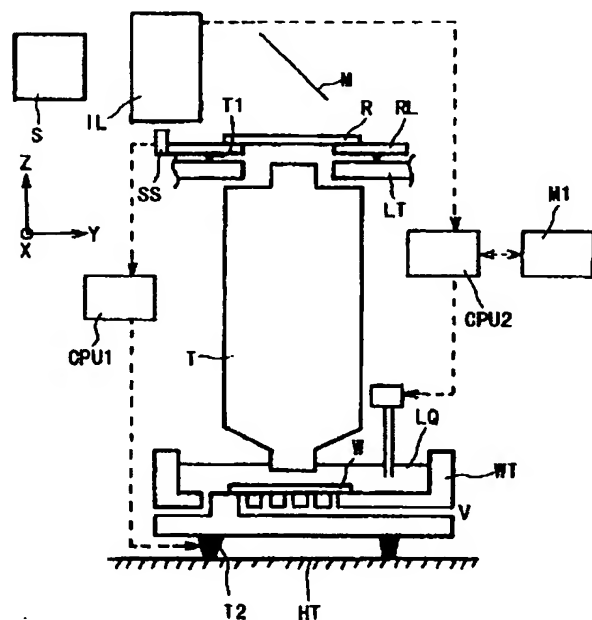
東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(54)【発明の名称】 露光装置及びその製造方法並びに露光方法及びデバイス製造方法

(57)【要約】

【課題】、連続的な結像性能の補正を振動を伴うことなく可能とすること、或いは投影光学系の開口数の増大及び結像性能の補正を両立すること

【解決手段】レチクルR上に設けられたパターンを照明する照明光学系I Lと、このパターンの像を感光性基板上に形成する投影光学系Tとを有し、投影光学系と感光性基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体L Qを介して露光を行う露光装置であって、液体の屈折率を調整するための屈折率調整手段を有する。



**【特許請求の範囲】**

【請求項 1】レチクル上に設けられたパターンを照明する照明光学系と、該パターンの像を感光性基板上に形成する投影光学系とを有し、前記投影光学系と前記感光性基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体を介して露光を行う露光装置において、前記液体の屈折率を調整するための屈折率調整手段を有することを特徴とする露光装置。

【請求項 2】前記屈折率調整手段は、前記投影光学系の結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 3】前記投影光学系の結像性能を測定する結像性能測定手段をさらに備え、前記屈折率調整手段は、前記結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項 2 記載の露光装置。

【請求項 4】前記投影光学系の結像性能の変動の要因の状態を検知する変動要因検知手段をさらに備え、前記屈折率調整手段は、前記要因の状態に応じて、前記結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項 1 記載の露光装置。

【請求項 5】前記照明光学系は、前記レチクルに対する照明条件を変更可能に構成され、前記変動要因検知手段は、前記照明条件の状態を検知し、

前記屈折率調整手段は、前記照明条件の変更に応じて、前記結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項 4 記載の露光装置。

【請求項 6】前記変動要因検知手段は、前記レチクルの種類を判別するものであり、前記屈折率調整手段は、前記レチクルの種類に応じて、前記結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項 4 記載の露光装置。

【請求項 7】前記感光性基板を保持する感光性基板ホルダーをさらに備え、該感光性基板ホルダーは、前記投影光学系と前記感光性基板との間の光路を前記液体で満たすための側壁と、前記液体を前記感光性基板ホルダーへ供給すると共に前記感光性基板ホルダーから回収するための供給・回収ユニットとを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか一項記載の露光装置。

【請求項 8】前記屈折率調整手段は、前記液体に屈折率を調整するための添加剤を供給する添加剤供給ユニットと、前記液体から前記添加剤を回収するための添加剤回収ユニットとを有することを特徴とする請求項 1 乃至 7 の何れか一項記載の露光装置。

【請求項 9】所定の照明条件のもとでレチクルを照明する工程と、前記レチクル上に設けられたパターンを投影光学系を用いて感光性基板上に転写する工程とを含み、前記投影光学系からの光を所定の液体を介して前記感光性

基板へ導く露光方法において、

前記投影光学系の結像性能を補正するために、前記液体の屈折率を調整する工程を含むことを特徴とする露光方法。

【請求項 10】所定の照明条件のもとでレチクルを照明する工程と、前記レチクル上に設けられたデバイスパターンを投影光学系を用いて感光性基板上に転写する工程とを含み、前記投影光学系からの光を所定の液体を介して前記感光性基板へ導くデバイス製造方法において、前記レチクル及び前記照明条件のうち少なくとも一方が変更されたときに、前記液体の屈折率を変更することを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項 11】レチクル上に設けられたパターンを照明する照明光学系と、該パターンの像を感光性基板上に形成する投影光学系とを有し、前記投影光学系と前記感光性基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体を介して露光を行う露光装置の製造方法において、前記投影光学系の結像性能を測定する工程と、該測定された結像性能に基づいて、前記液体の屈折率の初期値を定める工程とを含むことを特徴とする露光装置の製造方法。

**【発明の詳細な説明】****【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、レチクル上に設けられたデバイスパターンのを感光性基板上に投影する投影光学系を備えた露光装置及び該露光装置を用いた露光方法並びにデバイス製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は投影光学系と感光性基板との間の光路に液体を充填した液浸型露光装置に関する。本発明は、半導体素子、撮像素子（CCD等）、液晶表示素子、または薄膜磁気ヘッド等を製造する際に好適なものである。

**【0002】**

【従来の技術】光学系の最終面と像面との間の空間を、ワーキングディスタンスと言うが、従来の露光装置の投影光学系ではワーキングディスタンスは空気で満たされていた。ところで、ICやLSIを製造する過程に於いてシリコンウエハに露光するパターンは、その微細化が常に望まれていて、そのためには露光に用いる光の波長を短くするか、あるいは像側の開口数を大きくする必要がある。光の波長が短くなるにつれ、満足できる結像性能を得つつ露光に満足な光量を確保できるだけの透過率を持つガラス材料は少なくなってくる。

【0003】そこで像面までの最終媒質を、空気より屈折率の大きい、液体にすることで像側の開口数を大きくすることが提案されていて、そのように液体を用いた投影光学系を持つ露光装置は、液浸型露光装置と呼ばれている。さて、露光装置においては、投影光学系の結像性能を補正するために、投影光学系の最も物体側の光路或いは最も像側の光路中に、結像性能を調整するための結像性能補正部材を交換可能に設ける技術が知られてい

る。

#### 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、液浸型露光装置では、投影光学系と感光性基板との間の光路（ワーキングディスタンス）に液体を満たす構成であるため、結像性能を補正するための部材を配置することが困難である。また、このような結像性能補正部材は、有限の数、現実的な装置の構成を考えると数個程度しか準備することができないため、離散的にしか結像性能を補正できない問題点がある。

【0005】また、投影光学系の結像性能は所定の許容範囲に収める必要があるが、上述のように結像性能の補正が離散的にしかできなければ、この所定の許容範囲内に収めることが困難となる。特に、露光パターンの微細化や露光面積の増大が求められると、この結像性能の許容範囲が狭くなり、また、レチクルと感光性基板とを走査させつつ露光を行う走査露光方法を行う場合にも結像性能特性の変動幅の許容範囲が狭くなっており、離散的な補正では対応しきれない。

【0006】また、上述のような結像性能補正部材の交換時において、投影光学系自体の振動が発生するため、結像性能へ悪影響が生じる恐れもある。そこで、本発明は、連続的な結像性能の補正を振動を伴うことなく可能とすることを第1の目的とする。また、本発明は、投影光学系の開口数の増大と結像性能を補正することとの両立を第2の目的とする。

#### 【0007】

【課題を解決するための手段】上述の第1の目的を達成するために、本発明による露光装置は、レチクル上に設けられたパターンを照明する照明光学系と、このパターンの像を感光性基板上に形成する投影光学系とを有し、投影光学系と感光性基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体を介して露光を行う露光装置であって、液体の屈折率を調整するための屈折率調整手段を有するものである。

【0008】ここで、上記請求項2に掲げた好ましい態様によれば、屈折率調整手段は、前記投影光学系の結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。この構成に基づいて、請求項3に掲げた好ましい態様によれば、投影光学系の結像性能を測定する結像性能測定手段をさらに備えるものであり、屈折率調整手段

は、前記結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。

【0009】また、請求項4に掲げた好ましい態様によれば、投影光学系の結像性能の変動の要因の状態を検知する変動要因検知手段をさらに備えるものであり、屈折率調整手段は、要因の状態に応じて、結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。この構成に基づいて、請求項5に掲げた好ましい態様によれば、照明光学系は、前記レチクルに対する照明条件を変更可能に構成され、変動要因検知手段は、照明条件の状態を検知し、屈折率調整手段は、照明条件の変更に応じて、結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。

【0010】そして、請求項6に掲げた好ましい態様によれば、変動要因検知手段は、レチクルの種類を判別するものであり、屈折率調整手段は、レチクルの種類に応じて、結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。また、上述の第2の目的を達成するためには、投影光学系と感光性基板との間の光路の全てを液体で満たすことが好ましい。このとき、本発明による露光装置は、投影光学系と感光性基板との間の光路を前記液体で満たすための側壁と、液体を前記感光性基板ホルダーへ供給すると共に前記感光性基板ホルダーから回収するための供給・回収ユニットとを備え、感光性基板を保持する感光性基板ホルダーをさらに有することが好ましい。

【0011】また、屈折率調整手段は、液体に屈折率を調整するための添加剤を供給する添加剤供給ユニットと、液体から前記添加剤を回収するための添加剤回収ユニットとを有することが好ましい。

#### 【0012】

【発明の実施の形態】上述の構成のごとき本発明においては、投影光学系と感光性基板との間の光路中に位置する液体の屈折率を調整することができるため、この屈折率の変化により投影光学系の結像性能を補正することができる。ここで、屈折率調整の手法としては、液体が多物質の混合液体であるとする、この混合液体の屈折率  $n$  は、ローレンツ・ローレンス (Lorentz-Lorenz) の式に従い、

#### 【0013】

【数1】

$$\left( \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right) = \sum_{i=1,2,\dots} m_{(i)} \times \left( \frac{n_{(i)}^2 - 1}{n_{(i)}^2 + 2} \right) \times \frac{\rho}{\rho_{(i)}}$$

【0014】となる。但し、

【0015】

【数2】

$n_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の屈折率、  
 $m_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の重量分率、  
 $\rho_{(i)}$  :  $i$  番目の物質の密度、

【0016】である。例えば液体を水溶液とすると、この水溶液の屈折率が水溶液自体の濃度に応じて変化するため、水溶液へ添加する物質の濃度を増減させれば良い。これにより、投影光学系の結像性能を補償できる屈折率の値となるように、液体の屈折率を変化させれば、投影光学系の結像性能は良好なものとなる。

【0017】ここで、屈折率の調整は、例えば投影光学系の収差などの結像性能を測定し、その結果に応じて屈折率を調整しても良く、投影光学系の結像性能の変動に対応している要因の変動を検知して、その結果に応じて屈折率を調整しても良い。前者の投影光学系の結像性能を測定する手法においては、露光装置の製造時に投影光学系の収差などを測定し、この収差を補償する屈折率の値を液体の屈折率の初期値に設定しても良い。このように製造時の調整の一部として屈折率を調整すれば、製造・調整が容易となる利点がある。また、露光装置自体に収差測定機構などを設けておき、この収差測定機構による収差測定結果に応じて、液体の屈折率を変更しても良い。

【0018】一方、後者の結像性能の変動に対応する要因の変動としては、レチクルの種類、照明条件の状態、投影光学系を通過する露光エネルギー量などが挙げられる。ここで、レチクルを照明する際の照明条件（ $\sigma$ 値、変形照明か否かなど）は、レチクル上に設けられるパターンの種類によって最適なものが決まり、この照明条件が変わると、投影光学系の収差を初めとする結像性能が変化する。そこで、例えばレチクルの種類、照明条件などの要因ごとに、この要因の変動に伴って変化する結像性能を補償するための屈折率の値を予めメモリなどに記憶させておき、この要因の変動を検知し、記憶された関係に基づいて液体の屈折率を調整すれば良い。また、投影光学系を通過する露光エネルギー量の大小により投影光学系の結像性能が変化する、いわゆる照射変動があるが、この場合においても、露光エネルギー量と、この露光エネルギー量の大小によって変化する結像性能を補償するための屈折率の値を予めメモリなどに記憶させておき、この要因の変動を検知し、記憶された関係に基づいて液体の屈折率を調整すれば良い。なお、この手法において、メモリに記憶させる代わりに、所定の計算式で算出しても良い。

【0019】このように、液体の屈折率を調整することで、投影光学系の結像性能のうち、特に球面収差、像面湾曲の補正に効果的である。以下、図面を参照して、本発明にかかる実施の形態について説明する。

【第1の実施の形態】図1は、本発明にかかる第1の実施の形態による露光装置を概略的に示す図である。尚、図1では、XYZ座標系を採用している。

【0020】図1において、光源Sは、例えば波長248nmの露光光を供給し、この光源Sからの露光光は、照明光学系IL及び反射鏡Mを介してレチクルRをほぼ

均一な照度分布のもとで照明する。ここで、本例では光源Sとして、KrFエキシマレーザ光源を用いているが、その代わりに、193nmの露光光を供給するArFエキシマレーザ光源やg線、i線等を供給する高圧水銀ランプ等を用いても良い。また、図1では不図示ではあるが照明光学系ILは、面光源を形成するためのオプティカルインテグレータと、この面光源からの光を集光して被照射面を重畳的に均一照明するためのコンデンサ光学系と、オプティカルインテグレータにより形成される面光源の位置に配置されて面光源の形状を可変にするための可変開口絞りとを有するものである。ここで、面光源の形状としては、光軸から偏心した複数の面光源を持つもの、輪帯形状のもの、円形状であってその大きさがことなるものなどがある。このような照明光学系ILとしては、例えば米国特許第5,329,094号公報や米国特許第5,576,801号公報に開示されているものを用いることができる。

【0021】そして、レチクルRを通過・回折した露光光は、投影光学系Tを経てウエハW上に達し、ウエハ上には、レチクルRの像が形成される。ここで、レチクルRは、レチクルローダーRLによって保持され、レチクルローダーRLは任意の時にローダーテーブルLT上を駆動装置T1により、X軸及びY軸上で任意の速度で移動できるように構成されている。ここで、レチクルローダーRLのローダーテーブルLT上での移動速度は、速度センサーSSで検知され、この速度センサーSSからの出力は、第1制御部CPU1へ伝達される。

【0022】また、ウエハWは、ウエハテーブルWTにより保持されている。このウエハテーブルWTには、液体LQを溜めるための側壁が設けられている。本例では、この側壁により、ウエハWから投影光学系Tまでの光路の全てが液体LQで満たされる構成となっている。このウエハテーブルWTは、駆動装置T2によりホルダーテーブルHT上でX軸方向及びY軸方向に任意の速度で移動できるように構成されている。

【0023】ここで、上記の第1制御部CPU1は、レチクルローダーRLのローダーテーブルLT上での移動速度と、投影光学系Tの露光倍率 $\beta$ とからウエハテーブルWTのホルダーテーブル上での移動速度を算出し、駆動装置T2へ伝達する。駆動装置は、第1制御部CPU1から伝達された移動速度に基づいて、ウエハテーブルWTを移動させる。

【0024】図2は、このウエハテーブルWTの構成を詳細に表した図である。この図2において、投影光学系Tの最もウエハW側の光学部材と、投影光学系Tの金枠との間は、液体LQが浸透してこないように密着しているか、パッキングされている。また、ウエハテーブルWTの底部には、複数の開口が設けられており、これらの開口に接続されている配管Vから減圧することにより、ウエハWはウエハテーブルWTに吸着されている。そし



て、ウエハテーブルWTには、電極D1、D2が設けられており、これらの電極D1、D2のそれぞれの周囲には、イオン交換膜I1、I2が設けられている。これらのイオン交換膜I1、I2により、電極D1、D2の周囲と、露光光が液体LQを通過する領域とが区切られる。ここで、電極D1の周囲の雰囲気はイオン交換膜I1と隔壁K1とにより密閉空間となっており、この密閉空間には排気管H1が接続されている。また、電極D2の周囲の雰囲気はイオン交換膜I2と隔壁K2とにより密閉空間となっており、この密閉空間には排気管H2が接続されている。これらの排気管H1、H2は、ともに混合器Kに接続されている。この混合器Kには、電磁弁DVを備えた導入管LDの一端が接続されており、この導入管LDの他端は、ウエハテーブルWTの近傍に位置している。

【0025】電極D1、D2への印可電圧は図示なき電源供給部から供給され、電源供給部が供給する印可電圧は、第2制御部CPU2により制御される。また、電磁弁DVの開閉に関してもは、第2制御部CPU2が制御する。本例では、これらの電極D1、D2、イオン交換膜I1、I2、隔壁K1、K2、排気管H1、H2、混合器K、電磁弁DV、導入管LD、図示なき電源供給部、第2制御部CPU2が屈折率調整手段を構成している。

【0026】以下、屈折率調整手段の動作について説明する。以下の説明において、液体LQは、純水に添加剤として塩化水素を加えたものであるとしている。まず、液体LQの屈折率を下げる場合、第2制御部CPU2は、電源供給部へ指令を送り、電極D1及び電極D2の間に所定の電圧を所定の時間だけ加印する。このとき、陽極となる電極からは酸素気体が発生し、陰極となる電極からは水素と塩素との混合気体が発生する。このとき、液体LQにおける塩化水素濃度が下がるため、上記(1)式からもわかるように、液体LQの屈折率が低下する。ここで、各々の電極D1、D2の近傍で発生した気体は、イオン交換膜I1、I2を通過しないため、排気管H1、H2を介して回収することが可能である。この回収された気体は、混合器Kへ送られる。混合器Kでは、回収された気体(酸素気体、水素気体、塩化水素気体)が混ぜ合わせられ、これより、液体LQよりも高濃度の添加物水溶液が生成される。

【0027】また、液体LQの屈折率を上げる場合、第2制御部CPU2は、電磁弁DVを開いて高濃度の添加物水溶液を液体LQへ加えるように、電磁弁DVへ指令を送る。これにより、液体LQの屈折率が上昇する。この構成により、液体LQの屈折率を可変にできる。さて、第2制御部CPU2に接続されているメモリーM1には、種々の照明条件ごとに対応して屈折率の値がテーブルの形で記憶されている。ここで、屈折率の値は、ある照明条件下において投影光学系Tで生じる収差を補正

するために必要な液体LQの屈折率の値である。また、このメモリーM1には、ある時点における液体LQ中の添加物濃度の値が、常に更新される形で保管されている。

【0028】また、上記の照明光学系ILは、この照明光学系ILが形成する面光源の形状に関する情報を第2制御部CPU2へ伝達するために、第2制御部CPU2と接続されている。ここで、照明条件一本例では面光源の形状が変化すると、この情報は第2制御部CPU2へ伝達される。このとき、第2制御部CPU2は、伝達された照明条件に対応する屈折率の値をメモリーM1から検索し、その屈折率を実現するための添加物の濃度を上記(1)式から計算する。次に第2制御部CPU2は、メモリーM1に保管されている現在の添加物濃度と、計算された添加物濃度とに従って、現在の添加物濃度を計算された添加物濃度とするように、電極D1、D2あるいは電磁弁DVを制御する。

【0029】これにより、液体LQの屈折率の値は、液体LQを含めたときの投影光学系Tの収差が補正されるものとなる。

【第2の実施の形態】第2の実施の形態は、第1の実施の形態における添加物をエチルアルコールとした点が大きく異なる。このエチルアルコールは、感光性基板としてのレジストが塗布されたウエハWのレジスト層を溶解せず、投影光学系Tにおける最もウエハW側の光学部材(液体LQと接する光学部材)及びこの光学部材に施された光学コートへの影響が少ない利点がある。

【0030】また、第2の実施の形態においては、屈折率調整手段の構成が第1の実施の形態のものとは異なる。以下、図3を参照して屈折率調整手段の構成につき説明する。なお、図3において、図2に示したものと同一機能を有する部材には、同じ符号を付してある。第2の実施の形態によるウエハテーブルWTを示す図3において、第1の実施の形態のものとは異なる点は、添加物を液体LQへ供給するための添加物供給管LSと、純水を液体LQへ供給するための純水供給管WSと、液体LQがウエハテーブルWTから溢れないように液体LQを排出する排出管Lとを有する点である。

【0031】ここで、添加物供給管LS、純水供給管WS及び排出管Lには、添加物及び純水の供給量を調整するための電磁弁DVLS、DVWS及び液体LQの排出量を調整するための電磁弁DVLがそれぞれ設けられており、これらの電磁弁DVLS、DVWS、DVLの開閉は、第2制御部CPU2により制御されている。第2の実施の形態における屈折率調整時の動作について説明する。

【0032】まず、液体LQの屈折率を上げる場合、第2制御部CPU2は電磁弁DVLSを制御して、所定の量だけ添加物を液体LQへ加える。このとき、排出管Lから液体LQを所定の量だけ排出する。この排出する液

体 L Q の量は、加えられた添加物の量と同じであることが好ましい。これにより、液体 L Q 中の添加物濃度が高まり、その屈折率が上昇する。

【0033】また、液体 L Q の屈折率を下げる場合、第 2 制御部 CPU 2 は電磁弁 DVWS を制御して、所定の量だけ純水を液体 L Q へ加える。このとき、排出管 L から液体 L Q を所定の量だけ排出する。この排出する液体 L Q の量は、加えられた純水の量と同じであることが好ましい。これにより、液体 L Q 中の添加物濃度が低くなり、その屈折率が低下する。

【0034】ここで、加えられる添加物及び純水の量、排出する液体 L Q の量は、第 2 制御部 CPU 2 により制御される。なお、メモリー M 1 内に照明条件の種類に対応して屈折率の値が記憶される点、ある時点における液体 L Q の添加物濃度の値が保管される点は、上述の第 1 の実施の形態と同様であり、これらの情報に基づいて、投影光学系 T の収差を補正できる屈折率を実現するための添加物濃度を計算する点も第 1 の実施の形態と同様である。

【0035】このようにして、第 2 の実施の形態における第 2 制御部 CPU 2 は、メモリー M 1 に保管されている現在の添加物濃度と、計算された添加物濃度とに従って、現在の添加物濃度を計算された添加物濃度とするように、電磁弁 D V L S、D V W S、D V L の開閉を制御する。これにより、液体 L Q の屈折率の値は、液体 L Q を含めたときの投影光学系 T の収差が補正されるものとなる。

【第 3 の実施の形態】次に、図 4 を参照して第 3 の実施の形態について説明する。第 3 の実施の形態による露光装置は、収差測定装置を備えている点で上述の第 1 及び第 2 の実施の形態とは異なる。なお、図 4 において、上述の図 1 ～図 3 の例と同じ機能を有する部材には同じ符号を付してあり、図 1 と同様の X Y Z 座標系を採用している。

【0036】図 4 において、光源 S は、波長 248 nm の露光光を供給し、この光源 S からの露光光は、ビーム整形光学系 11 により所定形状の断面に整えられた後、第 1 フライアイレンズ 12 に入射する。第 1 フライアイレンズ 12 の射出側には、複数の光源像からなる 2 次光源が形成される。この 2 次光源からの露光光は、リレーレンズ系 13 F、13 R を経て第 2 フライアイレンズ 15 へ入射する。このリレーレンズ系は前群 13 F 及び後群 13 R から構成され、これらの前群 13 F 及び後群 13 R の間には、被照射面上でのスペックルを防止するための振動ミラー 14 が配置されている。

【0037】さて、第 2 フライアイレンズ 15 の射出面側には、第 1 フライアイレンズによる 2 次光源の像が複数形成され、これが 3 次光源となる。この 3 次光源が形成される位置には、所定の形状あるいは所定の大きさを持つ複数の開口絞りを設定できる可変開口絞り 16 が配

置されている。この可変開口絞り 16 は、例えば図 5 に示すように、石英などで構成された透明基板上にパターンニングされた 6 つの開口絞り 16 a ～ 16 e をターレット状に設けたものである。ここで、円形開口を持つ 2 つの開口絞り 16 a、16 b は、 $\sigma$  値（投影光学系の開口数に対する照明光学系の開口数）を変更するための絞りであり、輪帯形状を持つ 2 つの開口絞り 16 c、16 d は、互いに輪帯比の異なる絞りである。そして、残りの 2 つの開口絞り 16 e、16 f は、4 つの偏心した開口を有する絞りである。この可変開口絞り 16 は、可変開口絞り駆動ユニット 17 により、複数の開口絞り 16 a ～ 16 f のうち何れか一つが光路内に位置するように駆動される。

【0038】図 4 に戻って、可変開口絞り 16 からの露光光は、コンデンサレンズ系 18 により集光されてレチクルブラインド 19 上を重畳的に照明する。レチクルブラインド 19 は、リレー光学系 20 F、20 R に関してレチクル R のパターン形成面と共役配置されており、レチクルブラインド 19 の開口形状によりレチクル R 上での照明領域の形状が決定される。レチクルブラインド 19 からの露光光は、リレー光学系の前群 20 F、反射鏡 M 及びリレー光学系の後群 20 R を介してレチクル R 上の所定の位置に実質的に均一な照度分布の照明領域を形成する。

【0039】なお、前述の第 1 及び第 2 の実施の形態における照明光学系 11 は、この実施の形態に示したビーム整形光学系 11 ～リレー光学系 20 F、20 R を適用することもできる。さて、レチクル R は、レチクルローダー R L 上に載置されており、このレチクルローダー R L は、ホルダーテーブル L T 上で図中 X Y 方向及び Z 軸を中心とした回転方向 ( $\theta$  方向) に移動可能となっている。このレチクルローダー R L には、移動鏡 R I M が設けられており、レチクル干渉計 R I は、レチクルローダー R L の X Y 方向及び  $\theta$  方向の位置を検出する。また、レチクルローダー R L は、レチクルローダー駆動ユニット R L D により X Y 方向及び  $\theta$  方向へ駆動される。ここで、レチクル干渉計 R I からの出力は、第 1 制御部 CPU 1 へ伝達され、第 1 制御部 CPU 1 は、レチクルローダー駆動ユニット R L D を制御する構成となっている。

【0040】また、図示なきレチクルストッカーからの搬送路の途中には、レチクル R に設けられたバーコードを読みとるためのバーコードリーダー B R が設けられている。このバーコードリーダー B R が読みとったレチクル R の種類に関する情報は、第 2 制御部 CPU 2 へ伝達される。ここで、第 2 制御部 CPU 2 に接続されているメモリー M 1 には、レチクル R の種類ごとに最適な照明条件に関する情報と、レチクル R の種類ごとに最適な液体 L Q の屈折率の値とが記憶されている。

【0041】レチクル R の下側には、所定の縮小倍率  $\beta$  を有する投影光学系 T が設けられており、この投影

10

20

30

40

50

光学系Tの最もウエハ面側の光学部材とウエハWとの間には、液体LQが介在している。投影光学系Tは、この液体LQを介してウエハ面上にレチクルRの縮小像を形成する。ウエハWは、ウエハテーブルWTに吸着固定されており、このウエハテーブルWTは、ウエハテーブルWT自体のZ軸方向への移動やティルト（Z軸に対する傾き）を行わせるためのZアクチュエータZD1、ZD2、ZD3を介して、定盤に対してXY方向に移動可能なウエハステージWTSに取り付けられている。このウエハステージWTSは、ウエハステージ駆動ユニットWDにより駆動される。また、ウエハテーブルの側壁は鏡面加工が施されており、この部分がウエハ干渉計WIの移動鏡となっている。ここで、ウエハステージ駆動ユニットWDの駆動は上述の第1制御部CPU1で制御され、ウエハ干渉計WIからの出力は第1制御部CPU1へ伝達される構成となっている。

【0042】また、投影光学系Tには、投影光学系TとウエハWとの間のZ方向の距離を測定するためのフォーカスセンサAFが設けられている。このフォーカスセンサAFは、投影光学系TにおけるウエハW側に近い光学素子を介してウエハ面上に光を照射し、かつウエハで反射された光を上記光学素子を介して受光し、その受光位置により投影光学系TとウエハWとの間のZ方向の距離を測定するものである。このようなフォーカスセンサAFの構成は、例えば特開平6-66543号公報に開示されている。

【0043】さて、第3の実施の形態においても、添加物保管部LSTに貯蔵される高濃度の添加物水溶液を液体LQへ供給するための添加物供給管LSと、純水保管部WSTに貯蔵される純水を液体LQへ供給するための純水供給管WSとを備えており、添加物供給管LS及び純水供給管WSには、添加物水溶液及び純水の供給量を調整するための電磁弁DVL S、DVWSが設けられている。また、ウエハテーブルWTには、液体LQがウエハテーブルから溢れないように液体LQを排出するための排出管Lが設けられており、この排出管Lには、液体LQの排出量を調整するための電磁弁が設けられている。これらの電磁弁DVL S、DVWS、DVLの開閉は、上述の第2の実施の形態と同様に、第2制御部CPU2により制御されている。

【0044】また、ウエハテーブルWT上には、投影光学系の収差を測定するための収差測定部ASと、液体LQの添加物濃度を検出するための添加物濃度検出部DSとが設けられている。ここで、収差測定部ASとしては、例えば特開平6-84757号公報に開示されているものを用いることができる。ここで、収差測定部AS及び添加物濃度検出部DSからの出力は、第2制御部CPU2へ伝達される。また、添加物濃度検出部DSからの出力は、第2制御部CPU2を介してメモリーM1へある時点における液体LQの添加物濃度の値として保管され

る。

【0045】次に、第3の実施の形態の動作について説明する。まず、図示なきレチクルストッカーからレチクルRが取り出されてレチクルローダーRL上に載置される途中に、バーコードリーダーBRは、レチクルRに設けられているバーコードを読み取り、その情報を第2制御部CPU2へ伝達する。第2制御部CPU2は、メモリーM1に記憶されているレチクルRの種類に対応した照明条件に関する情報を読み出し、その情報に従って、可変開口絞り駆動ユニット17を制御して開口絞り16a～16fのうちの所定の一つを光路内に位置させる。また、第2制御部CPU2は、メモリーM1に記憶されている液体LQの屈折率の値に基づいて、その屈折率を実現するための添加物の濃度を上記(1)式から計算する。その後、添加物濃度検出部DSにより検出されてメモリーM1に保管されている現在の添加物濃度と、計算された添加物濃度とに従って、現在の添加物濃度を計算された添加物濃度とするように、電磁弁DVL S、DVWS、DVLの開閉を制御する。

【0046】これにより、液体LQの屈折率の値は、液体LQを含めたときの投影光学系Tの収差が補正されるものとなる。この後、フォーカスセンサAFによりウエハWのZ方向の位置及びティルトを検出して、ウエハWが所要の位置になるようにZアクチュエータZD1、ZD2、ZD3を駆動する。この状態において、光源Sからの露光光を照明光学系を介してレチクルRへ導き、第1制御部CPU1は、レチクル干渉計RI及びウエハ干渉計WIによりレチクルR及びウエハWの位置を検出しつつ、レチクルローダー駆動ユニットRLD及びウエハステージ駆動ユニットWDを駆動させ、レチクルR及びウエハWを投影光学系Tの投影倍率 $|\beta|$ の速度比の元で移動させる。これにより、レチクルR上のパターンは、良好な結像状態のもとでウエハW上へ転写される。

【0047】さて、投影光学系Tの結像性能（収差など）は、常に一定ではなく、温度変化や大気圧変化、投影光学系Tが露光光を吸収することによる温度上昇などにより変化する場合がある。そこで、第3の実施の形態では、収差測定部ASにより実際の投影光学系Tの収差（結像性能）を測定し、この測定結果に基づいて液体LQの屈折率の値を調整する構成としている。

【0048】具体的には、第3の実施の形態では、メモリーM1内に投影光学系の収差値に対応させた形で、その収差を補正できる液体LQの屈折率の値が記憶されている。そして、収差測定部ASにより検出された投影光学系Tの収差は、第2制御部CPU2へ伝達される。第2制御部CPU2は、メモリーM1内に記憶されている液体LQの屈折率の値を読み出し、この屈折率の値になるように添加物濃度を上記(1)式より求め、液体LQがその添加物濃度となるように電磁弁DVL S、DVWS、DVLの開閉を制御する。

【0049】この構成により、投影光学系Tの環境変化（温度変化、大気圧変動、露光光吸収による変動）があってもその結像性能を良好に維持することができる。なお、この収差測定部ASによる測定は、常時行う必要はなく、所定の周期ごとに行えば良い。

【第4の実施の形態】次に図6を参照して、第4の実施の形態について説明する。第4の実施の形態は、投影光学系とウエハとの間の光路の全てを液体で満たす構成ではなく、この光路の一部を液体で満たす構成としたものである。

【0050】図6(a)，(b)において、図1～3に示した第1及び第2の実施の形態と同じ機能を有する部材には同じ符号を伏してある。図6(a)，(b)に示す第4の実施の形態では、ウエハホルダーWTの側壁により液体LQを溜める代わりに、露光光を透過させる材料（例えば石英など）で構成された容器C1，C2中に液体LQを満たす構成が前述の第1及び第2の実施の形態とは異なる。この構成により、前述の第1及び第2の実施の形態が有していた効果のうち、開口数増大または実効的焦点深度拡大の効果はないものの、連続的に投影光学系Tの収差（結像性能）調整が可能となる効果は有している。

【0051】なお、この第4の実施の形態において、液体LQが入れている容器C1，C2を投影光学系Tと一体に設けても良い。以上の第1～第4の実施の形態では、液体LQとして純水を用いたが純水に限られることはない。

【0052】

【発明の効果】以上に示したように本発明によれば、投影光学系の結像性能を振動なく連続的に調整をすること

ができる。また、開口数の増大（或いは実効的な焦点深度の拡大）と結像性能の調整とを両立させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1及び第2の実施の形態にかかる露光装置を全体的に示す概略図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態にかかる露光装置の要部を示す断面図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態にかかる露光装置の要部を示す断面図である。

【図4】本発明の第3の実施の形態にかかる露光装置を示す概略図である。

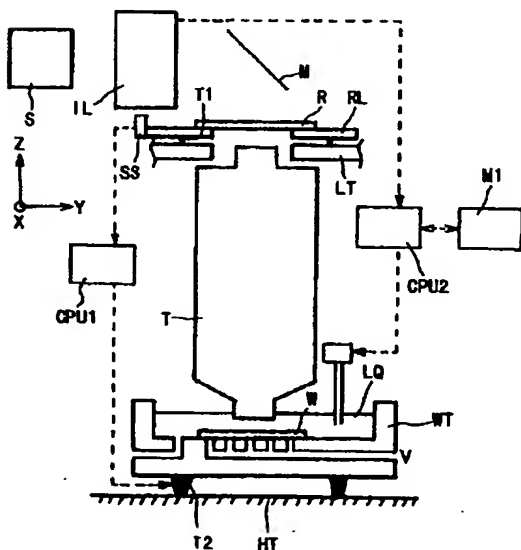
【図5】本発明の第3の実施の形態にかかる露光装置の一部を示す概略図である。

【図6】本発明の第4の実施の形態にかかる露光装置の要部を示す断面図である。

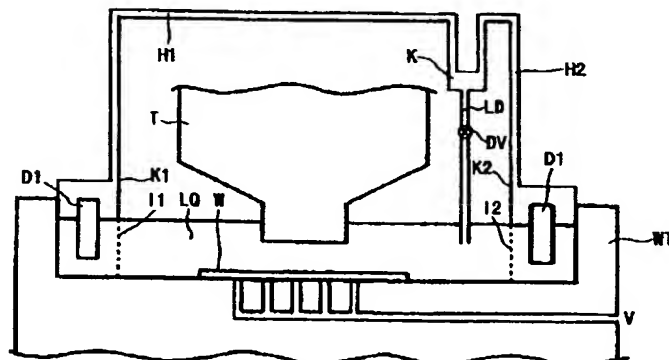
【符号の説明】

|             |             |
|-------------|-------------|
| S…光源        | T2…駆動装置     |
| IL…照明光学系    | M1…メモリー     |
| M…反射板       | V…減圧管       |
| T…投影光学系     | D1、D2…電極    |
| W…ウエハ膜      | I1、I2…イオン交換 |
| LQ…液体       | K1、K2…隔壁    |
| R…レチクル      | H1、H2…配管    |
| RL…レチクルローダー | L…排出管       |
| LT…ローダーテーブル | LD…導入管      |
| SS…センサー     | WS…純水供給管    |
| WT…ウエハテーブル  | LS…添加物供給管   |
| T1…駆動装置     |             |

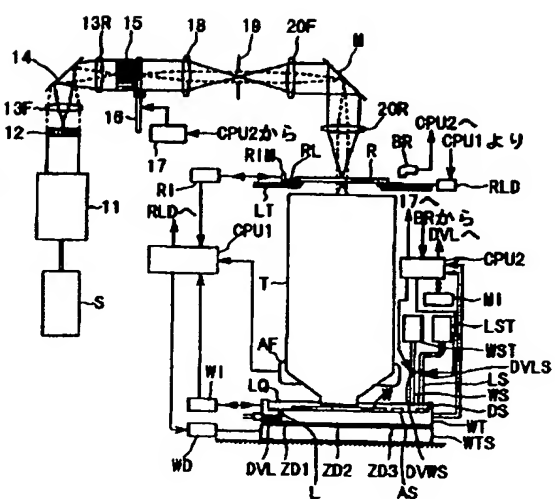
【図1】



【図2】



【图 4】



【図 6】

